

## 本期封面



2003年5期

栏目:

DOI:

论文题目: 脉冲偏压电弧离子低温沉积TiN 硬质薄膜的力学性能

作者姓名: 黄美东 孙超

工作单位: 中国科学院金属研究所 110016

通信作者: 闻立时

通信作者Email: [lswen@imr.ac.cn](mailto:lswen@imr.ac.cn)

文章摘要: 利用直流和脉冲偏压电弧离子镀技术沉积TiN 硬质薄膜, 研究了不同偏压下基体的沉积温度、薄膜的表面形貌及力学性能。结果表明, 与直流偏压相比, 脉冲偏压可以明显降低基体的沉积温度, 大大减少薄膜表面的大颗粒污染, 改善表面形貌, 而薄膜的综合力学性能仍保持良好, 说明利用脉冲偏压技术是实现电弧离子镀低温沉积的有效途径。

关键词: 电弧离子镀 低温沉积 脉冲偏压

分类号: TB43

关闭